

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 27 年 7 月 2 日 (2015.7.2)

【公開番号】特開 2014-229651 (P2014-229651A)
【公開日】平成 26 年 12 月 8 日 (2014.12.8)
【年通号数】公開・登録公報 2014-067
【出願番号】特願 2013-105985 (P2013-105985)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/66 B

【手続補正書】
【提出日】平成 27 年 5 月 13 日 (2015.5.13)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 2 0
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 0 2 0 】

次に、ステップ S 4 において、保護膜が形成される。保護膜となる膜は絶縁性膜である。この絶縁性膜は、電気的特性を評価する際に、熱的、化学的に安定であり、絶縁性能に優れた材料によって形成されることが好ましい。具体的には、フォトレジスト、絶縁性を有したシート（たとえば、ポリイミド、カプトン（登録商標）、ポリヘニルシルセスキオキサン、ポリビニルシルセスキオキサン）等であるが、これらに限られるものではない。なお、カプトンを適用する場合には、接着層を有するシート材が好ましい。